

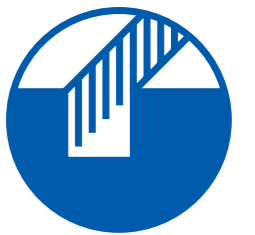
**samco**

会社案内

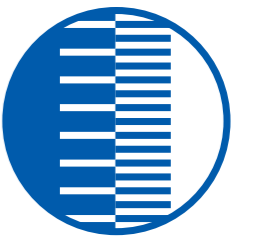
サムコ株式会社



deposition



etching



surface  
treatment

Corporate Profile **samco**  
Semiconductor And Materials COmpany

Thin Film Technology

2026  
Corporate Profile

Samco

# Kyoto to the world

## 「ごあいさつ」

### 挑戦の歴史を糧に、次世代の「豊かさ」を創り出す。

私たちの暮らしを支える半導体や電子部品。あまり意識されることはないかもしれませんが、私たちの生活を身近なところで支えている、なくてはならない存在です。

サムコは、半導体や電子部品の製造装置を世界中のお客様に提供する企業として、1979年(昭和54年)に創業しました。京都の片隅で生まれた小さなガレージカンパニーでしたが、独自の薄膜技術を磨き続けることで、世界中で自由にビジネスを行うグローバルカンパニーへと成長しました。

社名である Samco は Semiconductor And Materials Company の頭文字から名付けられました。半導体と材料開発の分野で価値を生み出していくという想いが込められています。創業当初から化合物半導体の研究開発に取り組み、数多くの独創的な製品を世に送り出してきました。

AIや自動運転などの技術が進化する現代において、半導体や電子部品は、さまざまな産業を支える不可欠な存在となっています。これらの技術は、社会の仕組みや私たちの生活を大きく変え始めています。

これからもサムコは、創業以来培ってきた技術と挑戦を大切にしながら、未来の社会を支える価値を世界に届けていきます。



代表取締役会長 兼 CEO  
つじ おさむ  
辻 理

代表取締役社長 兼 COO  
かわべ つかさ  
川邊 史

## 「経営理念」

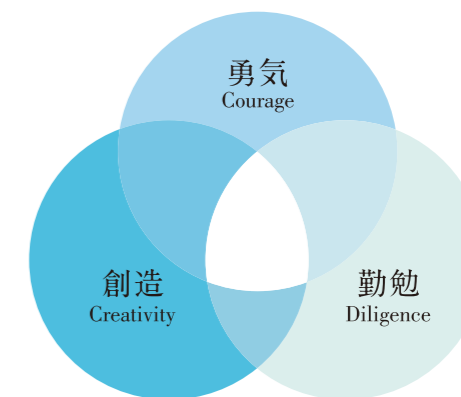
### 薄膜技術で 世界の産業科学に 貢献する。

私たちは、「<sup>はくまくぎじゆつ</sup>薄膜技術」をコアテクノロジーとして、さらなる成長を続け、企業価値を最大化してまいります。ステークホルダーの皆さまの信頼とご期待に応えるべく、事業活動を通じて社会的責任を果たすとともに、夢のある社会の実現と世界の産業科学の発展に貢献してまいります。今後とも皆さまの変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 「経営方針」

- 01 社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。
- 02 直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。
- 03 事業が社会に果たす役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

## 「行動指針」



# Core Technology

「コアテクノロジー」



CVD Systems

deposition



Dry Etching Systems

etching



Dry Cleaning Systems

surface treatment

Thin Film Technology

## はくまくぎじゅつ 薄膜技術

薄膜とはマイクロメートル( $\mu\text{m}$ )、ナノメートル( $\text{nm}$ )レベル\*の非常に薄い膜のことで、光の制御、表面の保護、絶縁性などさまざまな機能を持っています。サムコは薄膜を形成するCVD(化学気相成長)装置、薄膜を加工するドライエッチング装置、薄膜表面をクリーンにするドライ洗浄装置を製造しています。

\* $1\mu\text{m}=1/1,000\text{mm}$   
 $1\text{nm}=1/1,000,000\text{mm}$

※成膜・エッチング・表面処理のプロセスをイメージする上記ロゴマークはサムコの登録商標です。

# Products

「製品」

サムコは、半導体等電子部品製造装置メーカーです。私たちの暮らしを快適にする半導体や電子部品の進歩を陰で支える、さまざまなテクノロジーを高度に結合した最先端装置を製造・販売しています。

## CVD (化学気相成長) 装置

反応性の気体を半導体基板上に供給し、プラズマなどで化学反応させることにより薄膜を堆積させる装置です。半導体を水分やほこりから保護したり、絶縁性を持たせたりする目的で使用されます。サムコのCVD装置は、独自の原料を用いた液体ソースCVD®法に特長があり、比較的低温での高速成膜が可能です。

取扱  
製品

- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置
- ・ALD(原子層堆積)装置



ALD装置  
AD-8002LPC

薄膜  
形成

## ドライエッチング装置

半導体基板の薄膜を微細に加工する装置です。反応性の気体をプラズマ分解し、半導体基板の目的物と反応させて蝕刻していきものです。サムコは複数の元素を材料にしている化合物半導体の加工を得意としており、次世代パワーデバイスの材料である窒化ガリウム(GaN)や炭化シリコン(SiC)などの加工が可能です。

取扱  
製品

- ・反応性イオンエッチング装置
- ・ICPエッチング装置
- ・ALE(原子層加工)装置
- ・高速Siディープエッチング装置
- ・XeF<sub>2</sub>ドライエッチング装置



ICPエッチング装置  
RIE-800iPCT

微細  
加工

## ドライ洗浄装置

液体を用いないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて半導体基板の表面を洗浄する装置です。独自に開発したAqua Plasma®は銀や銅の表面還元や樹脂の接合など幅広い分野に応用されています。また、紫外線(UV)とオゾン(O<sub>3</sub>)を用いたUVオゾンクリーナーも取り揃えています。

取扱  
製品

- ・Aqua Plasma®クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー

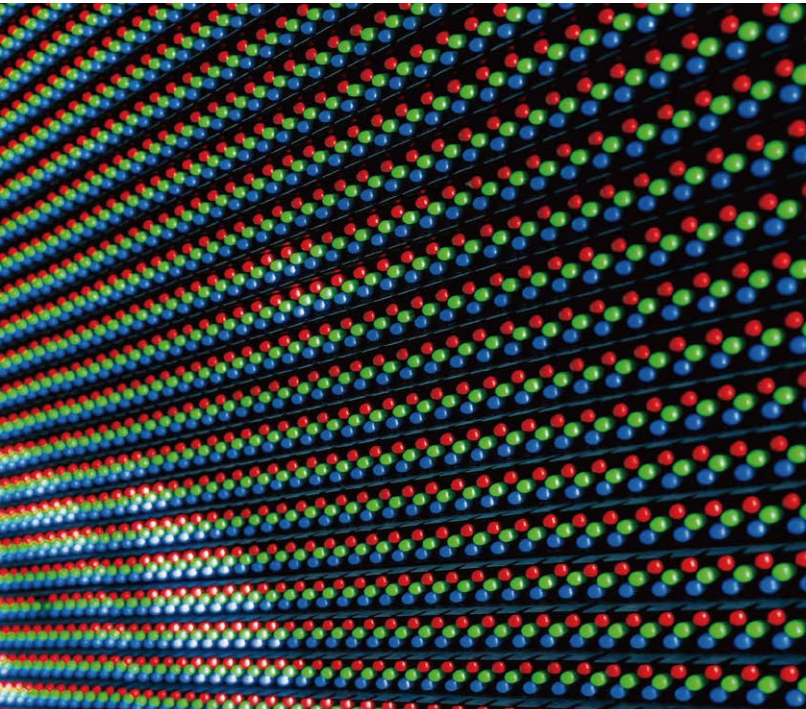


Aqua Plasma®クリーナー  
AQ-2000

洗浄・  
表面  
処理

# Applications

〔 応用分野 〕 私たちの暮らしを快適にする、サムコ装置の応用分野。



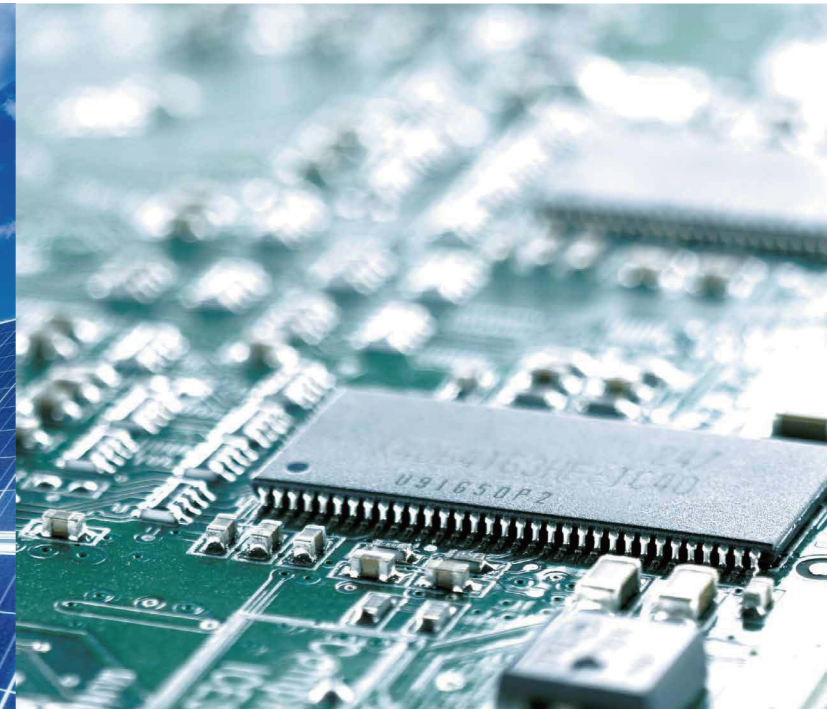
オプトエレクトロニクス



電子部品



次世代パワーデバイス



実装・表面処理

## 照明や光通信に使われる LEDや半導体レーザーなどの光デバイス

電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりするデバイスは、主に化合物半導体でつくられています。データセンターで用いられる近距離通信用の半導体レーザーや光導波路などのデバイスがあります。

## IoT (Internet of Things) を支える キーデバイス

高周波フィルタ・MEMS (Micro Electro Mechanical Systems = 微小電気機械素子) ・各種センサーなどの分野です。スマートフォンに多数搭載される高周波フィルタは、IoT時代を迎えその応用製品が飛躍的に増加しています。

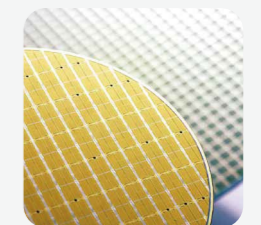
## 地球環境に貢献する 省エネ対策の切り札

電力を制御するパワーデバイスの材料は、シリコン (Si) が主流でしたが、さらなる電力損失の低減のため、窒化ガリウム (GaN) や炭化シリコン (SiC) といった化合物半導体を材料とした「次世代パワーデバイス」に注目が集まり、実用化が進んでいます。

## 電子機器の小型化、軽量化および 高機能化を実現する重要なプロセス

パッケージ工程前のドライ洗浄分野です。最先端パッケージとして注目が高まるファンアウトウエハーレベルパッケージ (FOWLP) をはじめ、高機能な電子機器を製造するために信頼性の高い洗浄が要求されます。

サムコ装置の  
応用分野



# Corporate Profile

## 〔 会社概要 〕

代表者	代表取締役会長 兼 CEO 辻 理 代表取締役社長 兼 COO 川邊 史
設立	1979年(昭和54年)9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田葦屋町36番地
資本金	16億6,368万円
売上高	93.4億円(2025年7月期)
従業員	191名(2025年7月)
証券コード	6387 東京証券取引所 プライム市場
事業内容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売 CVD装置・ドライエッチング装置・ドライ洗浄装置等
主要製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●薄膜形成分野                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラズマCVD装置</li> <li>・液体ソースCVD®装置</li> <li>・ALD装置</li> </ul> </li> <li>●微細加工分野                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・反応性イオンエッチング装置</li> <li>・ICPエッチング装置</li> <li>・ALE(原子層加工)装置</li> <li>・高速Siディーブエッチング装置</li> <li>・XeF<sub>2</sub>ドライエッチング装置</li> </ul> </li> <li>●洗浄・表面処理分野                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・Aqua Plasma®クリーナー</li> <li>・プラズマクリーナー</li> <li>・UVオゾンクリーナー</li> </ul> </li> </ul>

保有知的	国内特許 169件
所有権	海外特許 52件
	商標 33件

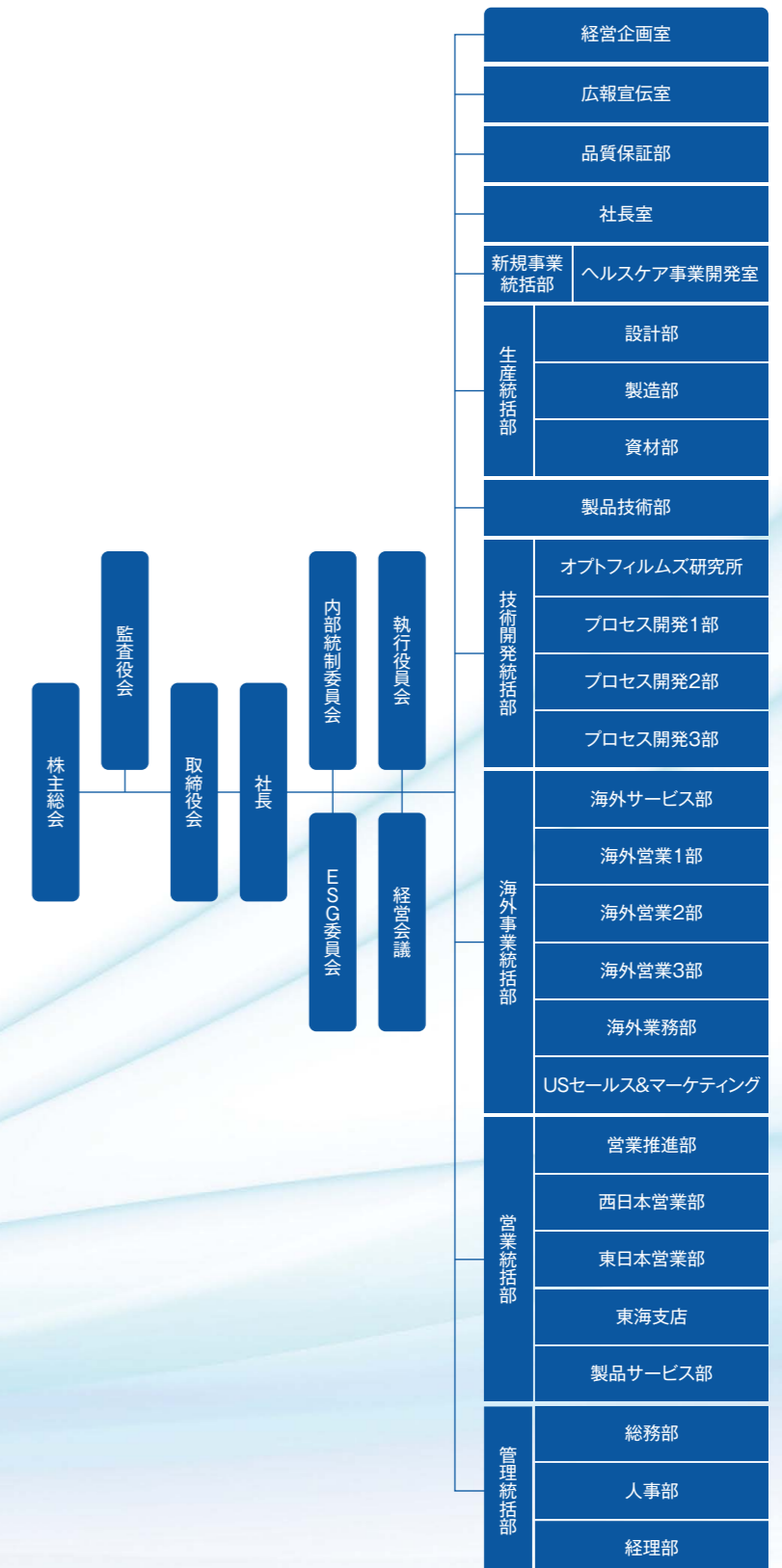
取締役	辻 理	代表取締役会長 兼 CEO
	川邊 史	代表取締役社長 兼 COO
	山下 晴彦	取締役専務執行役員 生産統括部長 兼 製造部長
	宮本 省三	取締役執行役員 管理統括部長 兼 経理部長
	佐藤 清志	取締役執行役員 営業統括部長
	村上 正紀	社外取締役
	高須 秀視	社外取締役
	藤田 静雄	社外取締役
	柳本 依子	社外取締役

監査役	辻村 茂	常勤監査役
	西尾 方宏	社外監査役
	木村 学	社外監査役

執行役員	松出 和男	執行役員 海外事業統括部 部長(海外事業管理統括)
	江崎 裕二	執行役員 資材部長
	ヘンリー・チャン	執行役員 USオペレーション担当部長
	上杉 能章	執行役員 海外事業統括部 部長(海外営業統括) 兼 海外営業1部長
	山本 潤	執行役員 営業副統括部長 兼 営業推進部長
	八田 博文	執行役員 人事部長
	山本 仁志	執行役員 総務部長 兼 経営企画室長

# Organization

## 〔 組織図 〕



2025年12月

# History

## 沿革

### 1979

1979 9月 資本金5,000,000円、株式会社サムコインターナショナル研究所を設立。



#### 設立

京都市伏見区の大手筋商店街近くの雑居ビル1階の車2台分のガレージで株式会社サムコインターナショナル研究所を創業。社員2名で太陽電池用のアモルファスシリコン薄膜形成用プラズマCVD装置を製作。

1979 10月 日米薄膜技術者による第1回薄膜技術セミナーを京都で開催。

### 1980~

- 1980 7月 半導体プロセス用大型CVD装置の開発、販売を開始。
- 9月 資本金を8,000,000円に増資。
- 1981 4月 国産初の化合物半導体製造用MOCVD装置の開発、販売を開始。
- 10月 資本金を12,000,000円に増資。
- 1982 8月 マルチチャンバーシステムPDM-303の開発、販売を開始。
- 10月 京都府中小企業改善補助金の交付を受ける。  
[アモルファスシリコン用3室分離回転式プラズマ反応器の開発研究]
- 1983 6月 通産省技術改善補助金の交付を受ける。  
[光励起による新型気相成長装置の開発研究]
- 1984 7月 世界初の紫外線—オゾン併用による新型フォトリソ除去装置、UVドライストリッパ—UV-1の開発に成功。
- 7月 東京営業所開設。
- 1985 5月 国産初の光CVD装置UVD-10の開発、販売を開始。
- 6月 新社屋完成につき、京都市伏見区竹田中宮町33に本社を移転。



#### 本社を現地に移転

京都市伏見区竹田中宮町33 (1997年に区画整理で町名変更、現在は竹田藁屋町36)に新社屋を竣工。本社を移転。

- 1986 1月 米国 March Instruments社と販売提携。
- 1987 2月 米国カリフォルニア州サニーベールにオプトフィルムズ研究所を開設。
- 6月 リアクティブイオンエッチング装置RIE-10Nの開発、販売を開始。
- 1988 7月 通産省技術改善補助金の交付を受ける。  
[高温超電導薄膜形成のための新型気相成長装置に関する研究]
- 1989 3月 第1回バイオニアオブサイヤー賞を受賞。
- 9月 設立10周年記念事業および薄膜技術講演会を開催。

### 1990~

- 1990 11月 LSCVD® 装置PD-240の開発、販売を開始。
- 1991 3月 京都市伏見区竹田中宮町27-3に研究開発センターを完成。



#### 研究開発センター完成

京都市伏見区竹田中宮町27-3 (現在は竹田中宮町94)に研究開発センターを竣工。ハード・ソフトの両面開発を目的に、クリーンルームを備えた実験室やCAD・デザイン室のほか、薄膜のメカニズムを研究して実用化につなげる研究室を設置。

- 11月 第9回サムコ薄膜技術セミナーを京都で開催。
- 12月 京都市伏見区竹田中宮町60に第2工場を新設。
- 1992 11月 第10回サムコ薄膜技術セミナーを東京で開催。
- 1993 2月 つくば出張所開設。
- 9月 東海営業所開設。
- 1994 2月 米国 Symatrix社と技術提携。
- 11月 京都産業技術振興財団技術大賞を受賞。
- 1995 7月 RITEの地球環境保全関係産業技術開発促進事業に参加。  
[特定フロン回収・固定化装置の実用化研究および生成物質の資源化研究]
- 1996 5月 台湾駐在員事務所開設。
- 12月 ICPエッチング装置RIE-1011Pの開発、販売を開始。
- 1997 11月 DLC膜のコーティングによるプラスチックボトルのリサイクル技術を確立。
- 1998 12月 ICPエッチング装置RIE-2001Pの開発、販売を開始。
- 1999 7月 設立20周年記念薄膜技術セミナーを東京で開催。

### 2000~

- 2000 1月 英国ケンブリッジ大学内にサムコ・ケンブリッジ・ラボラトリーを開設。
- 2001 5月 日本証券業協会店頭市場に上場。
- 5月 公募融資により資本金を1,213,787,288円に増資。
- 7月 つくば営業所開設。
- 7月 台湾事務所(新竹市)開設。
- 2002 7月 京都市伏見区竹田鳥羽殿町3に生産技術研究棟を完成。



#### 生産技術研究棟完成

京都市伏見区竹田鳥羽殿町3に生産技術研究棟を竣工。土地7114m<sup>2</sup>、建物鉄筋コンクリート造6階建延床面積7077m<sup>2</sup>。生産拠点および設計開発機能を集約。

- 2003 12月 化合物半導体量産用プラズマCVD装置PD-220LCの開発、販売を開始。
- 2004 10月 設立25周年記念薄膜技術セミナーを東京で開催。
- 11月 上海事務所開設。
- 12月 サムコ株式会社に社名変更。
- 2005 5月 研究試作用プラズマCVD装置PD-2203L(クラスターラボ)の開発、販売を開始。
- 2006 3月 京都市伏見区竹田藁屋町66に製品サービスセンターを新設。
- 4月 MEMS用高速Siエッチング装置RIE-800IPBの開発、販売を開始。
- 2007 11月 海外初の薄膜技術セミナーを中国清華大学で開催。
- 2008 3月 京都市伏見区竹田藁屋町67に第2研究開発棟を完成。
- 8月 韓国事務所開設。
- 2009 1月 サムコグローバルサービスが営業を開始。
- 4月 設立30周年記念。感謝の会を京都で開催。

### 2010~

- 2010 8月 米国東海岸にサムコ・イースト・コースト・オフィスを開設。台南サービスオフィス開設。
- 9月 北京事務所開設。
- 2011 4月 第16回薄膜技術セミナーを北京大学で開催。
- 2012 11月 SiCパワーデバイス向けドライエッチング装置RIE-600IPの開発、販売を開始。
- 2013 7月 東京証券取引所市場第二部に上場。
- 2014 1月 東京証券取引所市場第一部に上場。



#### 東証一部上場

東京証券取引所市場第二部への市場変更から5ヵ月余りの短期間で、東京証券取引所市場一部指定を受けた。

- 2014 3月 米国Valence Process Equipment, Inc.とMOCVD装置の販売代理店契約を締結。
- 5月 リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化。(samco-ucp AGに社名変更)
- 2015 9月 公募増資により資本金を1,663,687千円に増資。
- 12月 スウェーデンEpiLuvac ABとSiCエピタキシャル成膜装置の販売代理店契約を締結。
- 12月 電子デバイス向け原子層堆積装置AL-1の開発、販売を開始。
- 2016 6月 第二生産技術棟(京都市伏見区)が完成。
- 8月 マレーシアにマレーシア事務所を開設。
- 9月 Aqua Plasma® を用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始。
- 2018 5月 米国カリフォルニア州サンタクララにオプトフィルムズ研究所を移転。
- 2019 9月 設立40周年記念。感謝の会を京都で開催。

### 2020~

- 2020 1月 東海支店を愛知県名古屋へ移転。
- 7月 第二生産技術棟内にCVD装置、ALD装置のデモルームを開設。
- 7月 公益財団法人京都産業21より新型コロナウイルス感染症対策技術結集事業として補助金の交付を受ける。「水蒸気プラズマを用いた減菌器の製品化」
- 2021 3月 新型コロナウイルス不活化技術を完成。
- 12月 電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH™」の販売を開始。
- 2022 3月 第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ。
- 4月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所第一部からプライム市場へ移行。
- 10月 研究開発用プラズマALD装置AD-800LPの開発、販売を開始。
- 2023 10月 マルチチャンバープラズマCVD装置PD-2203LCの開発、販売を開始。
- 11月 東スイス応用科学大学との連携を開始。欧州市場の開拓販売を開始。
- 2025 9月 先端技術開発棟(京都市伏見区)が完成。
- 12月 原子層レベルの加工を実現するALE装置の開発、販売を開始。
- 2026 3月 2反応室ALD装置AD-8002LPCの開発、販売を開始。

# Locations

## 事業拠点

### サムコ 株式会社

	国内拠点
本社	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36 TEL (075) 621-7841 FAX (075) 621-0936
研究開発センター	〒612-8444 京都市伏見区竹田中宮町94 TEL (075) 623-0365 FAX (075) 623-0373
製品サービスセンター	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町66 TEL (075) 621-3600 FAX (075) 621-5057
生産技術研究棟	〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町3 TEL (075) 621-7840 FAX (075) 623-1071
第二研究開発棟	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町67 TEL (075) 623-3660 FAX (075) 623-3666
第二生産技術棟	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町68 TEL (075) 748-6601
先端技術開発棟	〒612-8444 京都市伏見区竹田中宮町93 TEL (075) 623-0365

	国内営業拠点
西日本営業部	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36 TEL (075) 621-7501 FAX (075) 621-0936
東日本営業部	〒141-0031 東京都品川区西五反田7-25-3 (THビル) TEL (03) 3492-3891 FAX (03) 3495-5796
東海支店	〒465-0043 名古屋市中東区宝が丘270 名古屋セントラルインタービル 4階 TEL (052) 715-5285 FAX (052) 715-5286
つくば営業所	〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 105号 TEL (029) 851-3801 FAX (029) 851-3809

	海外拠点
オプトフィルムズ研究所	2302 Walsh Ave Santa Clara, CA 95051 U.S.A. TEL 1-408-734-0459
イーストコーストオフィス	33 Wood Avenue South, Suite 600, Office No. 633, Iselin, NJ 08830, U.S.A. TEL 1-631-464-0664
北京事務所	Room 408, Jinghuan Building, Beihuqu Road, Chaoyang District, Beijing 100101 China TEL 86-10-8219-4215
上海事務所	Room L08, Floor 4, No.108 Yuyuan Road, Jingan District, Shanghai 200040 China TEL 86-21-6249-4662
韓国事務所	Daewoo Worldmark 102-809, 1620, Bongyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16704, Korea TEL 82-70-8252-7841
シンガポール支店	10 Anson Road, #21-07 International Plaza Singapore 079903 TEL 65-6465-4220
マレーシア事務所	C-8-21, Block C, Centum@Oasis Corporate Park, No.2, Jalan PUJ1A/2, Ara Diansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

	台湾 現地法人 サムコグローバルサービス
新竹本社	17F-8 Empire Commercial Bldg. 295 Kuang-Fu Rd., Sec. 2 Hsinchu 300 Taiwan, R.O.C. TEL 886-3-516-5100
台南サービスオフィス	1F., No. 65, Mingchuan St., Xinshi Dist., Tainan City 744001 Taiwan, R.O.C.
	リヒテンシュタイン 現地法人 samco-ucp ltd.
本社	Industriering 10 LI-9491 Ruggell, Liechtenstein

